

ATC施設利用・共同開発研究申請書 (☒新規 ☐継続 ☐変更)

国立天文台先端技術センター センター長 殿

平成 29 年 8 月30 日

下記のとおり施設利用を申請します。

①代表者氏名： 前嶋宏志		④ 連絡先： (E-mail)	
② 所属機関 / 部局 宇宙科学研究所 赤外線グループ		(電話)	
③ 職名 又は 学年 修士課程2年		(FAX)	
⑤ 研究課題名： コーティングを施した半導体基盤の赤外透過・反射スペクトル測定			
⑥ 研究課題および施設利用の目的		URL (省略可) : http://	
半導体基盤へのARコート，反射コートの性能を確かめるため，コーティングを施した基盤の赤外透過・反射スペクトルを，FTIR-410を用いて測定する。			
⑦ 希望利用期間： H29年10月2日 ～ H29年10月8日 (継続使用の場合は、一年毎の更新が必要です。)			
⑧ 利用者およびその連絡先(電話番号、E-Mail) 前嶋宏志， 道井亮介， 中川貴雄			
先端技術センターの関連職員の氏名を記入。(該当者がいない場合は記入不要)			
利用設備の申請 : 使用する項目にチェック (☒ or ☐) を入れてください。			
☐ メカニカルエンジニアリングショップ 業務依頼の内容を具体的に裏面に記入してください。	☐ 設計	☐ 実験スペース	___ × ___ m ²
	☐ 工作依頼	☐ 電源の使用	100V, ___ A , ___ 口
	☐ 測定・評価		200V, ___ A , ___ 口
	☐ 超精密	☐ クレーンの利用	この欄に利用クレーンの規模を記入して下さい。
☒ オプティカルショップ	測定器の予約はWebを利用して下さい。	☐ 特定化学物質	
☐ スペースチャンバショップ 裏面に作業内容を記入してください。	☐ 大型スペースチャンバ ☐ 中型真空チャンバ ☐ 小型真空チャンバ ☐ その他 ()	☐ 有機溶剤	この欄に使用する溶剤の種類を記入してください。持ち込む場合は、別途届出用紙に記入して提出してください。
		☐ 高圧ガス	別途届出用紙に記入して提出。
☐ 特殊蒸着・超微細加工ユニット 裏面に依頼内容を記載してください。	☐ 特殊蒸着	☐ 液体窒素： xx ℓ/月	☐ 乾燥窒素
	☐ 微細加工	☐ 液体ヘリウム： xx ℓ/月	ここに推定月使用料を記入して下さい。
☐ クリーンルーム (CR) 裏面に作業内容を記入して下さい。	☐ 大型CR(クラス1,000) ☐ 中型CR(クラス10,000) ☐ 小型CR(クラス10,000)	☐ 真空ポンプ 設備管理ユニットに予め相談 ☐ エレクトロニクス測定機器利用	☐ 冷却水の利用 ☐ サブミリ波FTS
	☐ その他 ()		
安全衛生講習 : 希望する ☒ 希望しない		保険加入の有無(学生のみ) : ☒ 有 ・ 無	

申請事項に変更が生じた場合は、速やかに変更申請書を作成し提出願います。

送付先 (先端技術センター事務) : atc-office@atc.mtk.nao.ac.jp

⑨ 利用計画 : 先端技術センターの設備・実験室等の利用計画(日程含む)を具体的に記入してください。また、工作依頼品の概要・利用する測定器・ソフト等についても記入してください。必要に応じて添付資料を提出してください。

(注意事項) : とくに大物を搬入、設置する場合や工事が必要になる可能性がある場合は、必ず記入して下さい。とくに大型実験機器の設置については、付属機器も含めた大体の配置図等を添付して提出してください。

(記入例)

2017年10月2日～ FTIR 実験機器セットアップ

試料の反射特性・透過スペクトルの測定

2017年10月8日 撤退予定

⑩ 国立天文台内のプロジェクトとの関連（なければ記入不要）

⑪ 国立天文台内該当プロジェクト長の推薦（なければ記入不要）

⑫ 共同開発研究を希望する場合、研究分担案などを記入してください。